PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLID STATE

V. 21, No. 4 (2020) pp. 689-694

DOI: 10.15330/pcss.21.4.689-694

ФІЗИКА І ХІМІЯ ТВЕРДОГО ТІЛА Т. 21, № 4 (2020) С. 689-694

УДК 537.311.322

ISSN 1729-4428

# В.А. Ромака<sup>1</sup>, Ю. Стадник<sup>2</sup>, Л. Ромака<sup>2</sup>, В. Крайовський<sup>1</sup>, А. Горинь<sup>2</sup>, П. Клизуб<sup>2</sup>, В. Пашкевич<sup>1</sup>

# Дослідження структурних, кінетичних та магнітних характеристик напівпровідника Er<sub>1-x</sub>Zr<sub>x</sub>NiSb

<sup>1</sup>Національний університет "Львівська політехніка, Львів, Україна, <u>volodymyr.romaka@gmail.com</u> <sup>2</sup>Львівський національний університет ім. І.Франка, Львів, Україна, <u>lyuboy.romaka@gmail.com</u>

Досліджено особливості структурних, кінетичних, енергетичних та магнітних характеристик напівпровідникового твердого розчину  $Er_{1-x}Zr_xNiSb$ , x = 0 - 0.10. Зроблено припущення, що при уведенні атомів Zr  $(4d^25s^2)$  у структуру пів-Гейслерової фази ErNiSb шляхом заміщення у позиції 4a атомів Er  $(5d^06s^2)$  атоми Zr також одночасно можуть займати позицію 4c атомів Ni  $(3d^84s^2)$ . Як результат, у напівпровіднику  $Er_{1-x}Zr_xNiSb$  одночасно генеруються як структурні дефекти донорної природи у позиції 4a і акцепторної у позиції 4c. При цьому у забороненій зоні  $Er_{1-x}Zr_xNiSb$  з'являються енергетичні стани домішкових донорної  $\varepsilon_D^2$  та акцепторної  $\varepsilon_A^1$  зон (донорно-акцепторні пари), які визначають механізми електропровідності напівпровідника.

Ключові слова: електропровідність, коефіцієнт термо-ерс, рівень Фермі.

Подано до редакції 30.09.2020; прийнято до друку 15.12.2020.

#### Вступ

Перспективним, однак малодослідженим класом термочутливих матеріалів структурного типу (СТ) MgAgAs, є сполуки RNiSb та тверді розчини на їхній основі, де R – рідкісноземельний метал. При дослідженні фазових рівноваг в потрійних системах R-Ni-Sb встановлено існування сполук еквіатомного [1]. легких складу Однак для випадків рідкісноземельних металів (La, Ce, Pr, Nd, Sm) сполуки кристалізуються у двох  $CT - AlB_2$  та ZrBeSi [2, 3]. Натомість, сполуки RNiSb з важкими рідкісноземельними металами кристалізуються у СТ MgAgAs. У свою чергу, антимонід GdNiSb існує у структурних модифікаціях лвох високотемпературній з гексагональною структурою (CT AlB<sub>2</sub>) та низькотемпературній – CT MgAgAs. Нагадаємо, що Gd знаходиться посередині лантаноїдного ряду і його 4f-оболонка містить 7 електронів з 14.

Сполуки RNiSb, які мають структуру типу MgAgAs, є напівпровідниками та перспективними термочутливими матеріалами [4, 5]. Саме це є головним мотиватором нашої уваги до даного класу сполук. Поєднання високих термоелектричних характеристик та магнітних властивостей пів-Гейслерових фаз на основі рідкісноземельних та перехідних металів є гарною відправною точкою для нового класу термоелектричних матеріалів.

У [6, 7] показано, що термоелектричні властивості пів-Гейслерових фаз у багатьох випадках сильно залежать від термічної обробки, що впливає на дефектність кристалічної речовини. У цьому дослідження фазових контексті рівноваг У відповідній системі є важливим кроком для розуміння впливу способів отримання, термічної обробки та зарядового і розмірного факторів на існування сполук та твердих розчинів на їхній основі. синтезувати Такі дослідження дозволять багатокомпонентні термочутливі матеріали зi стабільними та відтворюваними характеристиками до температури гомогенізуючого відпалу, шляхом легування пів-Гейслерових фаз.

Дослідження особливостей структурних, енергетичних та кінетичних характеристик напівпровідників *p*-GdNiSb та *p*-LuNiSb у діапазоні температур T = 4.2 - 400 К дозволило запропонувати модель кристалічної структури сполуки LuNiSb [8]. Розрахунки розподілу густини електронних станів (DOS) p-LuNiSb показали, що при оптимальному варіанті заповнення кристалографічних позицій сполуки LuNiSb з'являється заборонена зона між енергетичними рівнями валентної зони та зони провідності, а рівень Фермі  $\varepsilon_F$  розташовується біля краю валентної зони, чому в експерименті відповідають додатні значення коефіцієнта термоерс. Цей результат повністю узгоджується з результатами експериментальних досліджень.

оптимальному При варіанті заповнення кристалографічних позицій сполуки LuNiSb розрахунки DOS дають глибину залягання рівня Фермі відносно краю валентної зони:  $\varepsilon_F = 28,4$  меВ, а дослідження кінетичних характеристик давали значення  $\varepsilon_F = 23,9$  меВ. Зазначимо, що точність розрахунків становить  $\pm 7 \text{ MeB}$ (ширина енергетичного контуру (eB) до кількості точок в енергетичному контурі). Використовуючи прив'язку до числових значень енергії активації  $\mathcal{E}_1^{\rho}$  з рівня Фермі є<sub>г</sub> на рівень протікання валентної зони для p-LuNiSb, визначену з високотемпературної ділянки залежності  $\ln(\rho(1/T))$ , шукали ступінь компенсації напівпровідника, який забезпечить у розрахунках DOS саме таке розташування рівня Фермі  $\varepsilon_{F}$ . Виявилося, що найбільш прийнятним і оптимальним є варіант розташування атомів, який передбачає наступне заповнення кристалографічних позицій сполуки LuNiSb: Ni(4c) = 92,65 % Ni + 1,35 % Lu + 6 % Vac; Lu(4a) = 100 % Lu; Sb(4b) = 100 % Sb. Для інших варіантів заповнення кристалографічних позицій LuNiSb, заборонена зона зникає, що передбачає металічну провідність і не узгоджується з результатами кінетичних досліджень [8].

У даному контексті цікавими видаються результати досліджень термочутливих матеріалів на пів-Гейслера, основі фаз зокрема напівпровідникового твердого розчину Er<sub>1-x</sub>Zr<sub>x</sub>NiSb, x = 0 - 0,15, у якому атоми рідкісноземельного металу Er володіють локальним магнітним моментом. У представленій роботі наведено експериментальні результати структурних, кінетичних, енергетичних та характеристик магнітних отриманого напівпровідникового твердого розчину Er<sub>1-x</sub>Zr<sub>x</sub>NiSb, x = 0 - 0.15. Детальному вивченню особливостей кристалічної та електронної структур сполуки ErNiSb, а також процесів їхньої трансформації при уведенні домішкових атомів Zr (механізм генерування структурних дефектів та відповідних енергетичних рівнів) буде присвячена наша наступна робота.

#### I. Методики дослідження

Зразки  $Er_{1-x}Zr_xNiSb$ , x=0-0.15, синтезовано шляхом сплавляння шихти вихідних компонентів в електродуговій печі в інертній атмосфері очищеного аргону з наступним гомогенізуючим відпалюванням впродовж 720 год за температури 1073 К. Для

компенсації втрат на випаровування додавали надлишок 1-3 мас.% Sb. Масиви дифракційних даних отримані на порошковому дифрактометрі DRON-4.0 (Fe $K\alpha$ -випромінювання). Кристалографічні параметри розраховані за допомогою програми FullProf Suite [9]. Хімічний і фазовий склад виготовлених зразків контролювали методом енергодисперсійної рентгенівської спектроскопії (ЕДРС) у поєднанні з растровим електронним мікроскопом-мікроаналізатором Tescan Vega 3 LMU (використані К- і L-спектральні лінії). Для синтезованих зразків Er<sub>1-x</sub>Zr<sub>x</sub>NiSb вимірювалися температурні і концентраційні залежності питомого електроопору ( $\rho$ ) і коефіцієнта термо-ерс ( $\alpha$ ) відносно міді за температур T = 80 – 400 К та питомої магнітної сприйнятливості  $\chi(x)$  методом Фарадея за температури T = 300 К.

#### **II.** Структурні дослідження Er<sub>1-x</sub>Zr<sub>x</sub>NiSb

Для дослідження синтезовано дві серії зразків твердого розчину  $Er_{1-x}Zr_xNiSb$  з певним інтервалом у часі. Рентгеноструктурні дослідження твердого розчину  $Er_{1-x}Zr_xNiSb$  показали, що отримані дифрактограми двох серій зразків індексуються у *CT* MgAgAs [4] і на них відсутні відбиття сторонніх фаз. У свою чергу, дослідження елементного складу поверхні зразків встановило їхню відповідність складу шихти.

A priori ми міркували наступним чином. Якщо у сполуці ErNiSb відбувається заміщення у позиції 4а атомів Er ( $r_{\rm Er} = 0,178$  нм) на атоми Zr ( $r_{\rm Zr} = 0,160$  нм), очікуваним було зменшення значень періоду елементарної a(x), оскільки атомний радіус Ег є більший ніж Zr. Однак значення a(x) Er<sub>1-x</sub>Zr<sub>x</sub>NiSb за концентрацій x = 0 - 0.02 стрімко зростають (рис. 1). За більших концентрацій, на ділянці x = 0.02 - 0.03, значення a(x) стрімко спадають, а потім так само стрімко наростають на ділянці x = 0.03 - 0.05. І лише x > 0.05значення періоду комірки 38 a(x)термочутливого матеріалу Er<sub>1-x</sub>Zr<sub>x</sub>NiSb зменшується.



**Рис. 1.** Зміна значень періоду комірки a(x)Ег<sub>1-х</sub>Zr<sub>x</sub>NiSb. <u>Вставка</u>: зміна a(x) у зразках, отриманих раніше.



Рис. 2. Температурні залежності питомого опору  $\ln(\rho(1/T))$  (1) та коефіцієнта термо-ерс  $\alpha(1/T)$  (2) Er<sub>1-x</sub>Zr<sub>x</sub>NiSb.

Спочатку немонотонний характер зміни значень періоду комірки  $a(x) Er_{1-x}Zr_xNiSb$  ми пов'язували з некерованими процесами при отриманні зразків. Адже точність рентгеноструктурного методу лежить за межами концентрацій домішок у напівпровіднику та не дозволяє їх ідентифікувати. Однак, результати попередніх досліджень структурних характеристик  $Er_{1-x}Zr_xNiSb$ , зокрема, зміни значень періоду комірки a(x) для обох серій зразків показали їхню подібність (рис. 1). Це дозволяє припустити, що виявлені на залежностях  $a(x) Er_{1-x}Zr_xNiSb$  особливості є проявом змін структури у процесі уведення атомів Zr і не можуть бути пов'язані з якістю приготування зразків шляхом сплавлення шихти в електродуговій печі з наступним гомогенізуючим відпалюванням.

Отже, поведінка періоду комірки  $a(x) \operatorname{Er}_{1-x}\operatorname{Zr}_x\operatorname{NiSb}$  дозволяє стверджувати, що домішкові атоми Zr, уведені у матрицю пів-Гейслерової фази ErNiSb, можуть також частково займати інші кристалографічні позиції, зокрема, позицію 4*c* атомів

Ni, або спричиняти появу інших структурних дефектів, наприклад, вакансій або атомів у пустотах структури [6-8].

Враховуючи. шо атомний раліус Ni  $(r_{Ni} = 0,124 \text{ нм})$  є найменшим у  $\text{Er}_{1-x}\text{Zr}_x\text{NiSb}$   $(r_{Sb} =$ 0,159 нм), то ріст залежності періода комірки a(x)термочутливого матеріалу Er<sub>1-x</sub>Zr<sub>x</sub>NiSb може бути спричинений лише одночасним частковим зайняттям домішковими атомами Zr позиції 4c атомів Ni. За аналогією, збільшення значень a(x) за x = 0.03 - 0.05також можна пояснити витісненням атомів Ni з позиції 4c атомами Zr. 3 іншого боку, заміщення атомів Ni  $(3d^84s^2)$  атомами Zr  $(4d^25s^2)$  генерує у кристалі структурні дефекти акцепторної природи, оскільки атом Zr містить менше d-електронів. У такому випадку зразки  $Er_{1-x}Zr_xNiSb$ , x = 0 - 0.02, будуть напівпровідниками р-типу провідності з додатними значеннями коефіцієнта термо-ерс  $\alpha(x,T)$ .

Зменшення значень періоду комірки a(x) на ділянці концентрацій x = 0.02 - 0.03 може бути



Рис. 3. Зміна значень питомого опору  $\rho(x,T)$  (*a*) та коефіцієнта термо-ерс  $\alpha(x,T)$  (*b*)  $\text{Er}_{1-x}\text{Zr}_x\text{NiSb}$  за різних температур: 1 - T = 80 K, 2 - T = 250 K, 3 - T = 300 K, 4 - T = 380 K.

спричинене зайняттям домішковими атомами Zr позиції 4*a* атомів Er (4 $f^{12}6s^2$ ), що генеруватиме структурні дефекти донорної природи. В експерименті значення коефіцієнта термо-ерс  $\alpha(x,T)$ повинні бути від'ємними. Подібною є логіка міркувань для зразків термочутливого матеріалу Er<sub>1-x</sub>Zr<sub>x</sub>NiSb, x > 0,05, коли період комірки a(x)зменшується.

Ми свідомі того, що наведені міркування стосовно елементарних заміщень у структурі  $Er_{1-x}Zr_xNiSb \in$  далекими від складних структурних змін у реальному кристалі. Враховуючи також дефектну будову ізоструктурної сполуки LuNiSb [8], в якій у позиції 4*c* атомів Ni присутні вакансії (6 %), а також атоми Lu (1,35 %), можемо припустити складний характер змін у різних кристалографічних позиціях твердого розчину  $Er_{1-x}Zr_xNiSb$ .

Результати дослідження електрокінетичних, енергетичних та магнітних характеристик зразків  $Er_{1-x}Zr_xNiSb, x = 0 - 0.15$ , у поєднанні з моделюванням цих характеристик дозволять зменшити у майбутньому варіантність моделей їхніх кристалічної та електронної структур та встановити кристалічну структуру, максимально наближену до реального стану речовини.

#### III. Дослідження кінетичних, енергетичних та магнітних характеристик Er<sub>1-x</sub>Zr<sub>x</sub>NiSb

Температурні та концентраційні залежності питомого опору  $\rho$  та коефіцієнта термо-ерс  $\alpha$  зразків  $Er_{1-x}Zr_xNiSb$ , x = 0 - 0, 10, наведено на рис. 2, 3, Залежності  $\ln(\rho(1/T))$ відповідно. та  $\alpha(1/T)$  $Er_{1-x}Zr_xNiSb$ , x = 0 - 0.03, типовими € лля компенсованих напівпровідників з активаційними ділянками та зміною знаку коефіцієнта термо-ерс  $\alpha(T,x)$ , що вказує на наявність кількох типів активаційних механізмів електропровідності за участю електронів та дірок.

Для зразків  $\text{Er}_{1-x}\text{Zr}_x\text{NiSb}, 0 \le x \le 0.03$ , у яких на залежностях  $\ln(\rho(1/T))$  присутні високотемпературні

активаційні ділянки, рівень Фермі  $\varepsilon_F$  розташований у забороненій зоні. З високотемпературних активаційних ділянок залежностей  $\ln(\rho(1/T))$ обчислено значення енергії активації з рівня Фермі  $\varepsilon_F$ у зони неперервних енергій  $\varepsilon_1^{\rho}$ , а з залежностей  $\alpha(1/T)$  – значення енергій активації  $\varepsilon_1^{\alpha}$ , що дають значення амплітуди модуляції зон неперервних енергій сильно легованого та сильно компенсованого напівпровідника [10].

У випадку сполуки ErNiSb знак коефіцієнта термо-ерс  $\alpha(T,x)$  є додатним, що вказує на дірковий тип провідності, а рівень Фермі є<sub>F</sub> лежить біля валентної зони на відстані  $\varepsilon_1^{\rho} = 45,2$  меВ від рівня її протікання (рис. 4). Подібне розташування рівня Фермі  $\varepsilon_F$  мало місце при дослідженні сполук RNiSb (R = Gd, Lu) [8]. При цьому, амплітуда модуляції зон неперервних енергій у напівпровіднику ErNiSb становить  $\varepsilon_1^{\alpha} = 34,3$  меВ. Якщо припустити, що у випадку сполуці ErNiSb, як у LuNiSb, кристалографічна позиція 4c атомів Ni частково, до ~1%, зайнята атомами Er, а також у ній присутні вакансії (~6%), то у кристалі генеруються структурні дефекти акцепторної природи. Це приведе



**Рис. 4.** Зміна значень енергій активації  $\varepsilon_1^p(x)$  Ег<sub>1-x</sub>Zr<sub>x</sub>NiSb.

до появи у забороненій зоні напівпровідника кількох акцепторних рівнів (зон) з різною глибиною залягання, а рівень Фермі  $\varepsilon_F$  розташується біля рівня протікання валентної зони. В експериментальних дослідженнях коефіцієнт термо-ерс  $\alpha(T,x)$  матиме додатні значення. Запропонована модель просторового розташування атомів в ErNiSb узгоджується з результатами кінетичних досліджень (рис. 2, 3).

Ми планували, що заміщення у позиції 4а атомів Ег на Zr генеруватиме у кристалі донори. При цьому значення питомого опору  $\rho(x,T)$  повинні зростати через зменшення концентрації вільних дірок при іонізації акцепторів, а коефіцієнт термо-ерс  $\alpha(T,x)$  мав змінити знак з додатного на від'ємний. Однак, уведення до структури сполуки ErNiSb найменшої в експерименті концентрації атомів Zr (x = 0,005) не змінило знак коефіцієнта термо-ерс  $\alpha(T,x)$  і привело до зменшення значень питомого опору  $\rho(x, T)$  (рис. 3), а глибина залягання рівня Фермі єг відносно рівня валентної зони зменшилася протікання ло  $\varepsilon_1^{\rho} = 39,8$  меВ (рис. 4).

Отриманий результат є неочікуваним, оскільки для напівпровідника *p*-типу це можливо лише за умови збільшення концентрації акцепторних домішок, що супроводжується ростом концентрації вільних дірок, дрейфом рівня Фермі  $\varepsilon_F$  до валентної зони та зменшенням значень питомого електроопору  $\rho(x,T)$  Ег<sub>1-x</sub>Zr<sub>x</sub>NiSb за x = 0,005. Більше того, виходить, що домішкові атоми Zr не генерують донори і не займають кристалографічну позицію 4*a* атомів Ег.

Цей експериментальний результат показує, що у кристалічній структурі напівпровідника  $\text{Er}_{1-x}\text{Zr}_x\text{NiSb}$ , x = 0,005, відбулися зміни, які генерують структурні дефекти акцепторної природи, що породжує в забороненій зоні ще один домішковий акцепторний рівень (зону). На це також вказує зменшення амплітуди модуляції зон неперервних енергій  $\text{Er}_{1-x}\text{Zr}_x\text{NiSb}$  за x = 0,005 до значення  $\varepsilon_1^{\alpha} = 17,5$  меВ (рис. 5, крива 1). Таке можливе у випадку зайняття домішковими атомами Zr кристалографічної позиції 4c атомів Ni  $(3d^84s^2)$ , що генерує у кристалі структурні дефекти саме акцепторної природи (атом Zr володіє меншим числом *d*-електронів, ніж Ni).

У напівпровіднику  $\text{Er}_{1-x}\text{Zr}_x\text{NiSb}$ , x = 0,01, знак коефіцієнта термо-ерс  $\alpha(T,x)$  стає від'ємним за всіх температур, а електрони є основними носіями струму. Рівень Фермі  $\varepsilon_F$  за концентрації x = 0,01тепер лежить біля зони провідності на відстані 6,7 меВ від рівня її протікання. За більших концентрацій домішкових атомів Zr (0,01 < x) знак коефіцієнта термо-ерс  $\alpha(T,x)$  залишається від'ємним за всіх температур, на залежностях  $\ln(\rho(1/T))$  зникають активаційні ділянки, а значення питомого електроопору збільшуються з ростом температури.

Металізація електропровідності  $Er_{1-x}Zr_xNiSb$ , 0,01 < x, є результатом руху рівня Фермі  $\varepsilon_F$  до зони провідності напівпровідника з наступним перетином з рівнем її протікання. Така поведінка рівня Фермі  $\varepsilon_F$ зумовлена зростанням концентрації донорів, іонізація яких збільшує число вільних електронів. Даний результат можна пояснити заміщенням у позиції 4*а* 



**Рис. 5.** Зміна значень енергій активації  $\varepsilon_1^{\alpha}(x)$  (1) і магнітної сприйнятливості  $\chi(x)$  (2) за T = 300 K Er<sub>1-x</sub>Zr<sub>x</sub>NiSb

атомів Ег на Zr, що генеруватиме донори. При цьому відбувається зменшення ступеню компенсації напівпровідника, на що вказує зменшення амплітуди модуляції зон неперервних енергій від  $\varepsilon_1^{\alpha} = 11,7$  меВ для x = 0,01 до  $\varepsilon_1^{\alpha} = 8,2$  меВ для x = 0,05 (рис. 5).

Вимірювання магнітної сприйнятливості  $\chi(x)$  $Er_{1-x}Zr_xNiSb$  за температури T = 300 К (рис. 5, крива 2) також вказують на одночасне генерування у кристалі дефектів акцепторної та донорної природи. Зразки  $Er_{1-x}Zr_xNiSb$  є парамагнетиками Паулі, магнітна сприйнятливість  $\chi(x)$  яких визначається вільними електронами та пропорційна густині електронних станів на рівні Фермі  $g(\varepsilon_F)$ . За концентрацій x > 0 залежність  $\chi(x)$  стрімко спадає і проходить через мінімум за x = 0,01. Надалі залежність  $\chi(x)$  росте, досягає максимуму за x = 0.03, надалі зменшується. Оскільки  $\chi(x) \sim g(\varepsilon_F)$ , то ріст залежності  $\chi(x)$  Er<sub>1-x</sub>Zr<sub>x</sub>NiSb вказує на ріст густини станів на рівні Фермі  $g(\varepsilon_F)$ . Спад залежності  $\chi(x)$  $Er_{1-x}Zr_xNiSb$ , x > 0,03, засвідчує зменшення густини станів на рівні Фермі  $g(\varepsilon_F)$ , що може бути викликане металізацію електропровідності напівпровідника.

Отриманого та наведеного масиву експериментальних результатів досліджень термочутливого матеріалу Er<sub>1-x</sub>Zr<sub>x</sub>NiSb недостатньо для остаточних висновків стосовно просторового розташування атомів у напівпровіднику та побудови адекватних моделей електронної структури та механізмів електропровідності. Цe вимагає додаткових досліджень як кристалічної структури, зокрема, можливого існування області гомогенності сполуки ErNiSb, дослідження Er<sub>1-x</sub>Zr<sub>x</sub>NiSb за вищих температур гомогенізуючого відпалу, так i кінетичних та енергетичних характеристик y поєднанні з моделюванням цих характеристик тощо.

#### Висновки

Таким чином, наведені результати вказують на складний характер входження атомів Zr до структури сполуки ErNiSb. Зроблено припущення, що при уведенні атомів Zr  $(4d^25s^2)$  у структуру пів-

Гейслерової фази ErNiSb шляхом заміщення у позиції 4*a* атомів Er  $(5d^06s^2)$  атоми Zr також одночасно можуть займати позицію 4*c* атомів Ni  $(3d^{8}4s^2)$ . Як результат, у напівпровіднику Er<sub>1-x</sub>Zr<sub>x</sub>NiSb одночасно генеруються як структурні дефекти донорної природи у позиції 4*a* (Zr володіє більшим числом *d*-електронів, ніж Er), так і акцепторної у позиції 4*c* (у Ni більше 3*d*-електронів, ніж y Zr). При цьому у забороненій зоні Er<sub>1-x</sub>Zr<sub>x</sub>NiSb з'являються енергетичні стани домішкових донорної  $\varepsilon_D^2$  та акцепторної  $\varepsilon_A^4$  зон (донорно-акцепторні пари), які визначають механізми електропровідності

напівпровідника.

Ромака В.А. – професор, д.т.н., к.фм.н.;					
Стадник	Ю.В.	-	к.х.н.,	провідний	науковий
співробітник;					
Ромака	Л.П.	-	к.х.н.,	провідний	науковий
співробітник;					
Крайовський В.Я. – професор, д.т.н.;					
Горинь А.М к.х.н., старший науковий співробітник;					
<i>Клизуб П.П.</i> – студент;					
Пашкевич В.З к.т.н., доцент.					

- [1] O. Sologub, P.S. Salamakha. Rare earth antimony: [in]: Gschneidner K. (Ed.), Handbook on the Physics and Chemistry of Rare Earths (The Netherlands, Amsterdam 2003).
- [2] V.K. Pecharsky, J.V. Pankevich, O.I. Bodak, Sov. Phys. Crystallogr. (Ehgl. Transl) 28, 97 (1983).
- [3] K. Harties, W. Jeitschko, J. Alloys Compd. 226, 81 (1995) (https://doi.org/10.1016/0925-8388(95)01573-6).
- [4] В.А. Ромака, Ю.В. Стадник, В.Я. Крайовський, Л.П. Ромака, О.П. Гук, В.В. Ромака, М.М. Микийчук, А.М. Горинь, Новітні термочутливі матеріали та перетворювачі температури (Видавництво Львівської політехніки, Львів, 2020).
- [5] I. Karla, J. Pierre, R.V. Skolozdra, J. Alloys Compd. 265, 42 (1998) (<u>https://doi.org/10.1016/S0925-8388(97)00419-2)</u>.
- [6] В.А. Ромака, В.В. Ромака, Ю.В. Стадник, Інтерметалічні напівпровідники: властивості та застосування (Видавництво Львівської політехніки, Львів, 2011).
- [7] Yu. Stadnyk, V.A. Romaka, A. Horyn, L. Romaka, V. Krayovskyy, I. Romaniv, M. Rokomanuk, Phys. Chem. Sol. St., 21(1), 73 (2020) (<u>https://doi.org/10.15330/pcss.21.1.73-81</u>).
- [8] L.P. Romaka, D. Kaczorowski, A.M. Horyn, Yu.V. Stadnyk, V.Ya. Krayovskyy, V.V. Romaka, Phys. Chem. Solid State 17(1), 37 (2016) (<u>https://doi.org/10.15330/pcss.17.1.37-42</u>).
- [9] T. Roisnel, J. Rodriguez-Carvajal, Mater. Sci. Forum, Proc. EPDIC7, 378-381, 118 (2001) (<u>https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.378-381.118</u>).
- [10] B.I. Shklovskii and A.L. Efros, Electronic Properties of Doped Semiconductors (Springer, NY, 1984).

## V.A. Romaka<sup>1</sup>, Yu. Stadnyk<sup>2</sup>, L. Romaka<sup>2</sup>, V. Krayovskyy<sup>1</sup>, A. Horyn<sup>2</sup>, P. Klyzub<sup>2</sup>, V. Pashkevych<sup>1</sup>

### Study of the Structural, Electrokinetic and Magnetic Characteristics of the Er<sub>1-x</sub>Zr<sub>x</sub>NiSb Semiconductor

<sup>1</sup>National University "Lvivska Politechnika", Lviv, Ukraine, <u>volodymyr.romaka@gmail.com</u> <sup>2</sup>Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, Ukraine, <u>lyubov.romaka@gmail.com</u>

Peculiarities of the structural, electrokinetic, energetic, and magnetic characteristics of  $\text{Er}_{1-x}Zr_x\text{NiSb}$  semiconductive solid solution, x = 0 - 0.10, were studied. It was suggested that when  $\text{Zr} (4d^25s^2)$  atoms were introduced into the structure of the ErNiSb half-Heusler phase by substitution of  $\text{Er} (5d^06s^2)$  atoms in 4a position, Zr atoms can also simultaneously occupy the 4c position of Ni  $(3d^84s^2)$  atoms. As a result, in  $\text{Er}_{1-x}Zr_x\text{NiSb}$  semiconductor, the structural defects of donor nature in position 4a and ones of acceptor nature in position 4c were generated simultaneously. In this case, in the band gap of  $\text{Er}_{1-x}Zr_x\text{NiSb}$ , the energy states of impurity donor  $\varepsilon_D^2$  and acceptor  $\varepsilon_A^1$  bands (donor-acceptor pairs) appear and determine the electrical conductivity mechanism of the semiconductor.

Keywords: electrical conductivity, thermopower coefficient, Fermi level.